

目 次

1 はじめに	8-1
2 負水素イオン入射	8-2
2.1 水素イオン H^+ 入射	8-2
2.2 負水素イオン H^- 入射	8-2
2.3 ローレンツストリッピング	8-3
2.4 荷電変換	8-3
2.5 励起 H^0	8-4
2.6 横方向ペインティング入射	8-5
2.7 RCS入射システムの概要	8-6
3 RCSにおけるビーム入射調整	8-9
3.1 入射軌道制御	8-9
3.2 入射点での位相空間座標の同定	8-10
3.2.1 ビーム重心の時間領域解析による手法	8-10
3.2.2 同定手法の検証	8-12
3.3 横方向ペインティング入射調整	8-12
3.4 荷電変換膜における散乱調査	8-14
謝辞	8-15
参考文献	8-16